3.4 聚合物 P1~P3和 POSS-P1~POSS-P3 之光譜特性 分析

材料的光電特性主要表現在 UV-visible 吸收光譜、光激發光光譜 (photoluminescence, PL)以及電激發光(electroluminescence, EL)中, 此外,為了要計算 HOMO-LUMO 等能帶的相互關係,本實驗也進行 了循環電位伏安儀(cyclic voltage)的量測,以下各節茲將逐一分析所 得數據。

3.4.1 UV-Visible 吸收光譜分析

首先就吸收光譜來討論,高分子 P1~P3 和 POSS-P1~POSS-P3 有兩種狀態,一為溶液狀態,分別溶於 THF 及 toluene 中,另一是薄 膜狀態,其 UV-Visible 光譜分別見 Fig. 3-16~Fig. 3-21,這六個材料 無論溶於 THF 或 toluene 中,其吸收位置皆沒有明顯的改變,顯示溶 劑極性的不同並不改變這系列材料的光學性質。



Fig. 3-16 UV-visible absorption spectrum of P1



Fig. 3-18 UV-visible absorption spectrum of P2



Fig. 3-20 UV-visible absorption spectrum of P3



3.4.2 螢光(Fluorescence)光譜分析

本研究以螢光儀來量測各材料的螢光性質,實驗時以個別材料 之 UV -Visible 吸收光譜中的最大吸收波峰波長為激發波長,分別量 測各材料之薄膜及其分別溶在 THF 及 toluene 中的螢光放射光譜 (Photoluminescene, PL)見 Fig.3-22~Fig.3-27 。P1~P3 和 POSS-P1 ~POSS-P3 這六個材料所處的溶液狀態有兩種分別為 THF 及 toluene,而這兩種溶劑其極性以 THF 明顯較 toluene 為高,故在 Fig. 3-22~Fig. 3-27 中顯示,P1~P3 和 POSS-P1~POSS-P3 這六個材料, THF 溶液的螢光放射光譜皆會較 toluene 溶液產生紅位移。這是因為 就一般的情況下,當增加溶劑的極性時溶劑與材料在激發態的 diople-diople interaction 會增強,以致於使放射光譜產生紅位移。

一般來說,在薄膜狀態的 PL 皆較溶液狀態 PL 產生紅位移,這 是因為一般高分子在薄膜狀態時其分子鏈堆積較緊密,這通常會造成 interchain 或 intrachain interaction 的增加故會導致有紅位移的現象產 生。 而本實驗所合成出來的這六個材料中,P1~P3 和 POSS-P1~ POSS-P3 的 PL 性質表都符合以上所說的現象,在薄膜狀態的 PL 皆 較溶液狀態 PL 產生紅位移。至於 P1 雖然其在薄膜狀態的 PL 似乎是 較 THF 溶液狀態 PL 產生藍位移,但觀察 P1 在薄膜狀態的 PL 光譜 可以發現在波長較長的區域以上都有明顯肩帶(shoulder)產生,這亦 可以說是一種紅位移的表現。

83



Fig. 3-23 PL spectrum of POSS-P1



Fig. 3-25 PL spectrum of POSS-P2



Fig. 3-27 PL spectrum of POSS-P3

以下 Table. 3-3 為高分子 P1~P3 和 POSS-P1~POSS-P3 分別在 Film、THF、toluene 下之 UV-visible 吸收光譜與光激發光光譜 (photoluminescence, PL)數據。

Table.3-3	UV and PL	peaks of pol	ymers P1~P3	,and POSS-P1~	POSS-P3
			1	/	

polymer	$UV(\lambda_{max}(nm))$			$PL(\lambda_{max}(nm))$		
	THF	Toluene	Film	THF	Toluene	Film
P1	378	381	385	443	453	449
POSS-P1	375	378	380	441	442	449
P2	369(432)	373(434)	376(443)	541	554	555
POSS-P2	370(432)	370(434)	373(439)	538	551	552
P3	371(520)	376(521)	377(530)	630	650	654
POSS-P3	371(520)	375(521)	377(529)	631	651	652
		2.4				



3.4.3 循環伏安計量(Cyclic voltammetry)分析

為了瞭解發光材料於光激發光或電激發光過程中HOMO及 LUMO等能帶的高低關係,本實驗對高分子P1~P3 和POSS-P1~ POSS-P3 進行了循環伏安計量分析,實驗時以濃度 0.1M之 (n-Bu)₄NBF₄的acetonitrile溶液為電解質,高分子部分以塗覆在Pt電極 上量測,量測時以 50 mV/sec的速率掃描記錄其氧化還原曲線。

發光材料之能帶結構會直接影響其PL及EL的光色,故這一方面 的數據亦是評估發光材料的一項重要指標。對於發光材料之電子游離 能(Ionization potential, IP)與電子親和力(Electronic affinity, EA)數 據的取得,最簡單的方法就是以CV數據配合UV-visible光譜之吸收波 長數據來計算。一般發光材料IP、EA及能隙(Energy gap, Eg)的標準 表示法如下:

$$IP = 4.4 + E_{ox,onset}$$

EA = 4.4 + E_{red,onset}
E_g = IP - EA

由於高分子材料在量測CV所表現出的還原曲線會因為有水或其 它物質的出現而變得非常雜亂,導致材料本身的還原曲線並不明顯, 因而無法直接得到EA值,故對於高分子能隙的取得一般藉由 UV-visible光譜中的最長波長吸收峰的起始波長(λonset)來計算:

$$E_g = 1240 / \lambda_{onset}$$

其中λonset單位為nm,而所得Eg的單位為eV

Fig. 3-28~Fig. 3-33 列出高分子 P1~P3 和 POSS-P1~POSS-P3 的 CV 圖及計算後的能帶圖。



Fig. 3-29 Cyclic voltammogram of the oxidation and energy band diagram of POSS-P1



Fig. 3-31 Cyclic voltammogram of the oxidation and energy band diagram of POSS-P2



Fig. 3-33 Cyclic voltammogram of the oxidation and energy band diagram of POSS-P3

Table. 3-4 列出高分子P1~P3 和 POSS-P1~POSS-P3 的氧化電位 (E_{ox,onset})、能階差(Energy gap, E_g)、與HOMO、LUMO電位的數據。

polymer	E _g (eV)	E _{ox.onset} (eV)	HOMO(eV)	LUMO(eV)
P1	2.93	1.26	5.66	2.73
POSS-P1	2.84	1.25	5.65	2.81
P2	2.36	1.44	5.84	3.48
POSS-P2	2.42	1.37	5.77	3.34
P3	1.92	1.37	5.77	3.84
POSS-P3	1.99	1.36	5.76	3.77

Table. 3-4 Energy level of polymers P1~P3,and POSS-P1~POSS-P3

